引用信息: Zhang Guo-Dong. Acta Phys. -Chim. Sin., 1991, 7(03): 366-370 [张国栋. 物理化学学报, 1991, 7(03): 366-370]

本期目录 | 在线预览 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

研究简报

铁钝化膜半导体特性的光电化学研究

张国栋

华东冶金学院化学工程系,马鞍山 243002

摘要:

关键词: 铁钝化膜 半导体 光电化学行为 光电流 平带电位

收稿日期 1989-10-24 修回日期 1990-09-02 网络版发布日期 1991-06-15

通讯作者: 张国栋 Email:

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

木文信息

PDF(3273KB)

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ 铁钝化膜

▶ 半导体

▶ 光电化学行为

▶光电流

▶ 平带电位

本文作者相关文章

▶ 张国栋